

SAL1000B 粉体用 ALD 装置

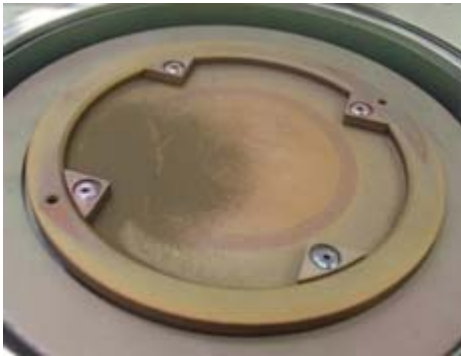


【装置コンセプト】

SAL1000B 粉体用ALD装置は、傾斜、回転、振動機構を装備しており、粉体を攪拌することで、粉体全面への成膜を可能にした研究開発用装置です。

コンパクトな卓上設置可能な装置で、プリカーサーは2系統内蔵しております。

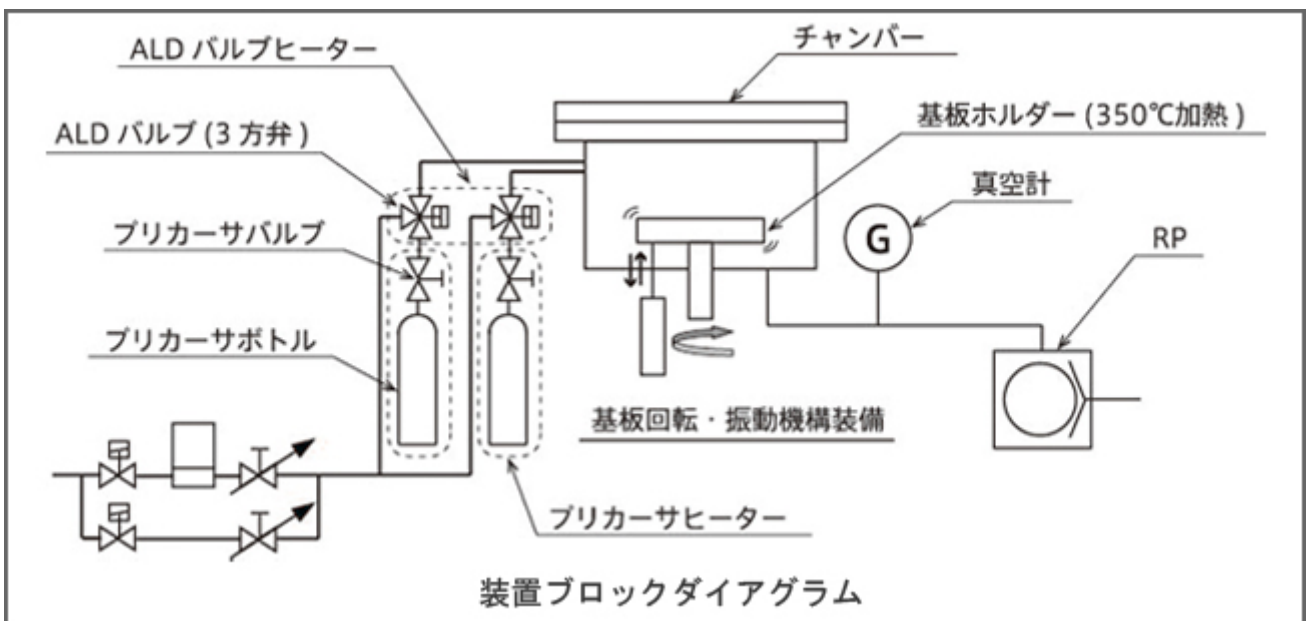
装置価格も800万円程度と お求めやすい価格に設定しました。



粉体用ホルダー

【特徴】

- ・操作はタッチパネルで成膜プロセスのレシピ設定や駆動機器の動作確認ができます。
- ・オプションでグローブボックスも取り付け可能です。
- ・粉体以外にもφ4"までの基板への成膜も可能です。



[性能及び仕様 (Performance & Component)]

到達圧力 (Vacuum Pressure)	≤5Pa	
膜厚分布 (Uniformity)	φ100mm Area ≤±3%	AlO ₃ にて (In Case of AlO ₃)
成膜方向 (Direction of deposition)	デポダウン (Deposition down)	
粉体容器 (Powder container)	銅製 (Copper)	
処理粉体量 (Powder quantity)	5CC	
粉体容器加熱温度 (Temperature of powder container heater)	350°C MAX	
プリカーサシリンダー (Precursor cylinder)	2 個 (2 pieces)	加熱温度 150°C Max (heating Temperature)
ALDバルブ (ALD valve)	パルス開閉 ≥15m sec (Pulse drive)	加熱温度 150°C (heating Temperature)
N ₂ パージガス機構 (Unit of N ₂ Purge gas)	ニードルバルブ、MFメーター付 (Needle valve with MF meter)	
排気ポンプ (Vacuum Pump)	162 L/min ロータリポンプ (Rotary Pump)	

[設置 (Space)]

本体 (Main Part)	重量 (Weight) 50Kg	面積 (Necessity Area) W650 × D750 × H650
ロータリポンプ (Rotary Pump)	重量 (Weight) 27Kg	

[用カ (Utility)]

電力 (Power)	3φ 200V ±10% 15A 50/60HZ
接地 (Ground)	D種接地 (GND for below 100 Ω)
パージガス (Purge gas)	N ₂ 0.1~0.2 MPa
圧縮空気 (Compressed air)	0.6~0.8 MPa
ポンプ排気 (Pump exhaust port)	ISO-KF25 フランジ (NW25 Flange)
筐体排気 (Frame exhaust port)	φ38 × L28 ダクトホースアダプター (Hose adapter)

[オプション (Option)]

グローブボックス (Glove box)	
プリカーサシリンダー加熱温度 (Precursor cylinder heater)	: 200°C MAX

評価機をご用意しておりますので、サンプルの作成も可能です。
また、特注仕様にも対応いたしますので、ご気軽にご相談ください。

お問い合わせ先
東横化学株式会社
事業開発室
Tel : 044-435-5858
<http://www.toyokokagaku.co.jp/>